

光・熱両用ナノインプリント装置シリーズ

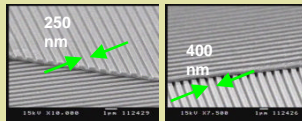
LTNIP-2000/LTNIP-5000/WMA-600

LINEUP

LTNIP-2000



Bi-layers RIL (transfer mode)



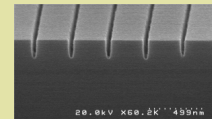
- PMMA on PMMA (Mw=120000)
- Upper stage: 170°C, Lower stage: 30°C
- Pressure: 10MPa
- Press time: 5min

PMMAによるリバーサルインプリント転写例
(平井教授ご提供)

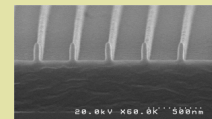
特徴

- レジスト材料の開発、評価に最適
- エアプレス方式を用い、最大50MPaまでプレス可能
- 加熱温度最大200°C
(両面加熱だが光インプリント使用時は片面加熱)
- チャンバーの真空機構あり
- 露光機能: 超高圧水銀UVランプ(波長選択可能)
- ステージサイズ: 標準58mmφ ワイド120mmφ

LTNIP-5000



【モールド】
50nm モールド(凸版印刷)



【転写パターン】
(東洋合成工業PAK-01)

特徴

- LTNIP-2000の上位機種。プレス圧最大20MPa
- サーボモータおよびボールネジ駆動で精密な加圧制御が可能
- 加熱温度最大200°C
(片面加熱)
- チャンバーの真空機構あり
- 自動モールド離型機構搭載
- 露光機能: 超高圧水銀UVランプ(波長選択可能)
- 適応基板サイズ: 6インチφ モールド: 最大40mm□

WMA-600



特徴

ナノインプリント用のアライメント装置もラインナップしている。アライメント装置WMA-600はウエハとモールドを5μm以下の精度で位置合わせし、モールドと基板をロックする。ロックされたモールド/基板を上記インプリント装置にセットすることで、精度の高い重ね合わせインプリントが可能となる。

リソテックジャパンでは、常時ご評価頂くためのデモ装置を準備しております。ご来訪の上、ご評価頂くか、サンプルを送付して頂ければ、各装置評価用のデータ取得を行いますので、お気軽にお申し付けください。また、特殊な仕様についても検討いたしますのでご相談ください。

【装置製造元】

LTJ リソテックジャパン株式会社
Litho Tech Japan

〒332-0034 埼玉県川口市並木2-6-6-201
TEL 048-258-6775 FAX 048-258-6673
E-mail: tech-support@ltj.co.jp

